

## 拒絶理由通知書

CA

特許出願の番号	特願2003-117828
起案日	平成19年12月14日
特許庁審査官	瀬良 聡機 9046 4E00
特許出願人代理人	岡本 啓三 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

## 理 由

A. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 2, 6
- ・引用文献等 1
- ・備考

引用文献1には、ガラスに形成された配線パターン領域にパラジウム溶液をインクジェットノズルで吹き付けパターン上にパラジウム触媒核を得ることが開示されている（【0068】～【0070】【図7】参照）。

B. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 2, 6, 7
- ・引用文献等 1～3
- ・備考